



一种三维等离激元光学聚焦结构的制备方法

专利名称: 一种三维等离激元光学聚焦结构的制备方法
专利类别: 发明
申请号: 2014102696949
第一发明人: 李无瑕
其它发明人: 李家方;牟佳佳;顾长志;李志远
专利授权日期: 2020-01-07

[关闭窗口](#)

